International Training Program オランダ Twente 大学 MESA+研究所 派遣報告

東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 中村 兆治

本報告書では独立行政法人日本学術振興会が主 催するインターナショナルトレーニングプログラ ムの長期派遣プログラムにおける研究活動ついて 報告する。

報告者は名古屋大学プラズマナノ工学研究セン ターにおける「プラズマナノ材料・デバイスプロ セス基礎研究人材育成プログラム」に参加した。 2012年10月22日から12月22日までオランダの Twente大学 MESA+研究所にて研究活動に従事 した。以下、派遣期間中の研究環境および成果に ついて報告する。

1. 研究環境

報告者が研究活動を行った MESA+研究所は、 オランダ最東部に位置する Enschede 市にある Twente 大学に附属する、世界屈指のナノテクノロ ジーに関する研究所である。オランダにおいては、 本研究所はナノテクノロジーに関する国家プロジ ェクト NanoNed を担う主要研究所の一つであり、 材料・加工技術研究において重要となる研究イン フラを有している。同研究所は、物理、電気工学、 化学および数学など幅広い分野の研究グループか ら構成されている。研究グループ間の学際的な共 同研究を活発化することで、ナノテクノロジー分 野におけるブレイクスルーの達成を目指している。

報告者は van den Berg 教授率いる BIOS グルー プにて研究活動に従事した。BIOS グループでは、 Lab-on-a-Chip (LOC) と呼ばれる微小流体デバイ スに関する研究を通じ、マイクロ・ナノテクノロ ジーを化学・物理学・ライフサイエンスと融合し、 クオリティー・オブ・ライフの向上に役立てるこ とを目指している。

BIOS グループは 50 人ほどが在籍しており、6 人の教員を筆頭に4人の技術職員、10人のポスド ク研究員、22人のPhD 学生、3人の修士学生等に よって構成されている。教員は各々が異なる研究 プロジェクトを牽引しており、ポスドク研究員お よびPhD学生による5人前後のチームで研究を行 っている。

PhD 学生は 9 時から 18 時まで研究を行うと、 速やかに帰宅していた。日本の研究室の風景とは かなり異なる。オン・オフの切り替えが非常に上 手という印象だった。また、教員も PhD 学生から 出る新たなアイデアに期待しており、とてもフラ ンクに PhD 学生と意見交換を行っていた場面も 頻繁に見受けられた。報告者も週に1度の頻度で ミーティングをする機会を設けていただき、研究 に関するディスカッションをさせていただいた。

2. 研究成果

報告者は、同グループ Eijkel 教授のご指導の下、 微小領域における塩化物イオン(CI)の挙動に関す る研究を行った。

2.1.背景

コンクリート構造物への CI の浸透は内部の鋼 材を腐食させるため、耐久性設計においてはその 浸透挙動を適切に予測する必要がある。現在の示 方書における塩害に対する耐久性照査では Fick の拡散則を用いて CI の浸透予測が行われている。 しかし、近年実施された実構造物の調査により、 高品質なコンクリートへの CI の浸透がある時点 から停滞する可能性が示唆されている。これは現 在の予測手法では、品質によっては過度に安全で 不経済な設計となる可能性を示している。もし CI の浸透停滞挙動を構造物の耐久性設計に組み込む ことが出来れば、設計の大幅な合理化が期待でき ると考えられる。しかし、コンクリートへの CI の浸透が停滞する機構に関しては不明な点が多い。

現在、主に考えられているそのメカニズムとして、ある閾値以下の径の空隙には、たとえ液状水で満たされているとしても、壁面とイオンの電気的相互作用により CI が浸入できないという可能

性が挙げられる。その閾値として 10nm ほどが妥 当であると数値解析によって示されているが、そ の値に関する実験的な検証はなされていない。し かし、コンクリートの微小空隙中の CI 挙動を直接 観察することは困難である。そこで本研究では、 ナノテクノロジー分野の計測技術を参考に、ナノ チャネルを有するガラス製チップおよび MQAE という、CIと反応するとその蛍光強度が減少する 蛍光試薬を用いて、空間サイズと CIの侵入挙動に 関して光学的手法による検討を行った。

2.2.実験

本研究で用いたチップは 3cm×3cm のガラス基 板上に2つのU字のマイクロチャネル(深さ30µm、 幅 500µm) およびそれらを繋ぐ 32 本のナノチャ ネル(深さ95、28、16nm、幅 5µm、長さ 500µm) から構成されている(写真1、図1)。チップの作 製はフォトリソグラフィーおよびウェットエッチ ングにより行った。下面の基盤にマイクロチャネ ルを、上面の基盤にナノチャネルをそれぞれエッ チングした後、それらを熱融着により接合するこ とでマイクロ/ナノ複合チップを作製した。

ナノチャネルに浸入した CIの検出には MQAE という CIと反応するとその蛍光強度が減少する 蛍光試薬を用いた。MQAEは1価の陽イオンであ り、CI濃度の増加とともにその蛍光強度が減少す る。また、その蛍光強度はBrやI、SCNによって も大きく減少するが、NO₃や SO₄²⁻、HCO₃などの アニオンによる影響はない。



実験に先立って、把握しておくべき MQAE の特 性が2つある。1つ目は、MQAE が水銀ランプか ら励起光を得る時、その照射時間の増加に伴って 蛍光強度が減少する Photo Bleaching である。これ を把握するために、2枚のガラスの間(距離 500µm) に濃度 0.25mM の MQAE 溶液を導入し、水銀ラン プから励起光を照射し続け、照射時間と蛍光強度 の関係を検討した。MQAE からの蛍光強度は画像 解析により取得した。結果を図2に示す。図より、 水銀ランプによる励起によって、10分程度まで急 激に発光強度が減少するものの、初期の7割程度 の発光強度で定常状態となっていることが確認で きる。通常の蛍光溶液と異なり、発光強度が0と ならなかった原因としてバックグラウンドの影響 が考えられるが、少なくとも実験に当たっては、 **図2**に示すように初期に急激な Photo Bleaching 挙 動があることを念頭に置く必要があることを確認 した。

2つ目は、MQAEの蛍光強度は CI濃度が高いほ ど減少するため(Quenching)、それらの関係を定 量的に把握する必要がある。そこで、MOAE 溶液 の濃度を 0.25mM の一定として、塩化カリウム溶 液(KCl)の濃度を変化させた場合の蛍光強度の 変化を測定した。方法は Photo Bleaching 特性把握 の時と同様に2枚のガラス間にMQAE溶液とKCI 溶液を同体積混合したものを導入し、その蛍光強 度を測定した。測定は3回ずつ実施しており、そ れらの結果の平均を図3に示す。図の縦軸の と MQAE 溶液に KCI 溶液を混合させた場合の蛍 光強度 (F_{KCI}) の比率である。図より、KCI 溶液 の濃度の増加に伴い、蛍光強度の減少率が増加し

ピラリーチューブとコネクタを用いてポンプに接続し、圧力により送液を制御した。ナノチャネル内の蛍光強度の変化の観察には蛍光顕微鏡を用いた。また、ナノチャネル中においては pH の低下により MQAE の蛍光強度が減少する可能性があるため、実験にはリン酸緩衝液(PB)を用いた。

実験手順は以下に示す通りである。まず、右の マイクロチャネルに濃度 1mM の PB を圧力 P_R=200mBar で 30 分間導入し、ナノチャネルを PB で満たす。その後、左のマイクロチャネルに濃度 0.25mMの MQAE 溶液と濃度 1mMの PB、濃度 5mM の KCl 溶液をそれぞれ同体積で混合した溶 液を圧力 P_L=100mBar で導入する。左のマイクロ チャネルから蛍光が確認されたら、P_R=P_I=0とし て流れを止め、時間毎に蛍光顕微鏡の画像を取得 し、画像解析によりナノチャネル内の蛍光強度を 測定する。この際、前項で検討した Photo Bleaching を防ぐために、水銀ランプからの励起光は顕微鏡 画像取得時のみ照射した。そして KCl を硝酸カリ ウム(KNO₃)で置換して同様実験を行い、それ らの蛍光強度を比較する。もし、ナノチャネル内 がほぼ電気二重層の内部になっているとすると、 ガラス表面とイオンの電気的相互作用により左の マイクロチャネル内に混在するイオンの内、陽イ オンである MQAE はナノチャネルに容易に浸入 できるのに対し、陰イオンである CI は浸入が抑制

Micro Channel



Nano Channel

写真 2 蛍光顕微鏡画像(左から 2, 10, 30 分)

され、KCIを混合した場合と KNO₃を混合した場 合のナノチャネルからの蛍光強度の差が小さくな るということが考えられる。

2.3.結果

写真2にナノチャネル深さ95nmのチップを用いた時のKNO3を混合した場合における各経過時間に取得された蛍光顕微鏡画像を示す。写真より、MQAEがナノチャネル中を左から右へと1次元的に拡散している様子が確認できる。

図5に拡散が定常に達している経過時間45分の 時のチャネル深さ 95、28、16nm それぞれにおけ る KCl を混合した場合の蛍光強度 FKCl と KNO3 を 混合した場合の蛍光強度 FKNO3 を比較した結果を 示す。チャネル深さ95nmにおいては、FKCIがFKNO3 と比較すると減少しており、ナノチャネル内に CI が浸入していることが確認できた。蛍光強度の比 率 F_{KN03}/F_{KCI}=1.36 となっている。チャネル深さ 28nm においては、 $F_{KNO3}/F_{KCI}=1.15$ となり、95nm の時と比較するとナノチャネルに浸入している CIの量が減少していることがわかる。そして、チ ャネル深さが 16nm の時は、FKN03/FKCI=1.06 とな り、ナノチャネル内には CIがほぼ浸入していない ということが確認された。今回の実験で使用した 溶液の濃度から電気二重層の厚さを表すデバイ長 を算出すると λ_p=6.7nm となる。すなわち、チャ ネル深さ 16nm の内、13.4nm が電気二重層内部と なっており、実質的に CIが浸入できる領域は 2.6nm となるため、その浸入が大きく抑制されて いると考えられる。

2.4.実験値と理論値の比較

Plecis et al.は電気的相互作用が重要となる微小 領域におけるイオン挙動の定量評価のために、 Exclusion-Enrichment coefficient βを以下のように 定義している。



$$\beta = \frac{C_{eff}(x)}{C^*(x)} = \frac{\langle C(x, z) \rangle_z}{C^*(x)}$$

ここで、 $C_{eff}(x)$:電気的相互作用下のイオンの 濃度、 $C^*(x)$:バルクでイオンの濃度である。まず、 今回の測定結果と上式から、Exclusion-Enrichment coefficient の実験値 β_{exp} を取得する。図 3 の Quenching Plot と前項で得られた蛍光強度の比率 F_{KNO3}/F_{KCI} から、ナノチャネルに存在する CI濃度 を取得する。そして、それらをバルクでの CI濃度 5mM で除した値を β_{exp} とした。

また、Plecis et al.を参考にすると、Exclusion-Enrichment coefficient の理論値 β_{pre} は以下の式で表 される。

$$\beta_{pre} = \frac{1}{h} \int_0^h \exp\left(-q \frac{\zeta \cosh((h/2 - z)/\lambda_D)}{\cosh(h/2\lambda_D)}/k_B T\right) dz$$

この式より、電気的相互作用が重要となる微小 領域におけるイオン挙動の定量評価のためには、 デバイ長さ λ_D のみならず、拡散しているイオンの 実効電荷 q およびガラス表面のゼータ電位くも重 要なパラメータであることがわかる。よって、 β の実験値と理論値を比較するためには、本実験に 用いたガラス表面のゼータ電位を取得しなくては ならない。Kirby et al.によると、1:1 対称電解質溶 液中のガラス表面のゼータ電位はバルクでのイオ ン濃度の対数と線形関係にあり、次の式のように 表される。

 $\zeta = a_0 + a_1 \log(c)$

ここで、 a_0 、 a_1 : ガラス表面の性質や溶液の種類に依存する定数である。Kirby et al.によると、 KCl 溶液を用いた時は、 a_0 は 0 となり、 a_1 は溶液の pH や温度に依存するということが報告されている。本実験に用いた溶液のpHは7.4、温度は25℃であり、これまでに数々の研究者により取得された実験値を参考にすると、この条件下での a_1 の値としては 30mV 程度が妥当であると考えられる。よって、この値を用いて本実験における理論値 β_{pre} を数値解析により算出した。

図 6 に β_{exp} と β_{pre} を比較した結果を示す。実験 値として 3 点しかないが、少なくともそれらの値 は理論値と精度よく一致していることが確認でき る。これより本実験結果の信頼性を示すとともに、 微小領域におけるイオン挙動を定量評価し得る可 能性を示すことができたと考えられる。



2.5.まとめ

以上の検討より、デバイ長さ程度の空間への CI の浸入が大きく抑制されることが確認できた。こ のことは、コンクリート中の主要な空隙サイズが µm~nm であることを鑑みると、コンクリート内 においても、本研究で検討したような要因により、 CIの浸透が抑制され、結果として停滞が生じてい る可能性を示唆していると考えられる。しかし、 陰イオンである CIの浸透が抑制されるためには、 コンクリート空隙壁面表面のゼータ電位が負にな らなくてはならない。今後、各種コンクリートの 空隙壁面のゼータ電位を測定することで、本研究 で示された可能性の検証が進むと考えられる。

3. おわりに

本プログラムでは、専門知識を学んだだけでは なく、英語のコミュニケーション能力を向上させ ることができた。また、日本とは異なる文化や芸 術に触れ、様々なバックグラウンドを持つ方々と 交流を持つことで、自身の視野を広げることがで きたと感じる。これからの大学院での研究にとっ て、研究活動に対する考え方を再考するよい機会 となった。

最後に、この貴重な機会を与えてくださった豊田教授、加地准教授をはじめとする名古屋大学の 先生方、東京大学生産技術研究所の火原准教授、 江良様をはじめとする ITP 事務局の方々、研究に 際して懇切丁寧にご指導いただきました Twente 大学 Eijkel 教授、le Gac 助教、また、チップ作成 に関して多大なご指導をいただきました東京大学 の福山様に厚く御礼申し上げます。